計量法第135条第2項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等

特定標準器による校	特定標準器による校正等を行う計量器	特定標準器による校正等に用いる	
正等を行う者	又は標準物質	特定標準器等又は特定標準物質	
平成27年4月1日	平成27年4月1日公示分		
国立研究開発法人	633ナノメートルよう素分子吸収線波長安	協定世界時に同期した原子時計及び	
産業技術総合研究所	定化ヘリウムネオンレーザ装置	光周波数コム装置であって、国立研	
		究開発法人産業技術総合研究所が保	
		管するもの	
	標準分銅であって、特定標準器による校正等	標準分銅群であって、国立研究開発	
	が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)	法人産業技術総合研究所が保管する	
	が1ミリグラム以上20キログラム以下のも	もの	
	o o		
国立研究開発法人	原子時計又は周波数標準器であって、出力さ	協定世界時に同期した原子時計であ	
産業技術総合研究所	れる周波数が5メガヘルツ又は10メガヘル	って、国立研究開発法人産業技術総	
又は	ツのもの	合研究所が保管するもの又は国立研	
国立研究開発法人		究開発法人情報通信研究機構が保管	
情報通信研究機構		するもの	
日本電気計器検定所	温度計校正用の水の三重点実現装置、インジ	温度計校正用の水の三重点実現装	
	ウム点実現装置又は白金抵抗温度計であっ	置、インジウム点実現装置、水銀点	
	て、校正範囲が一50度以上420度以下の 	実現装置、スズ点実現装置及び亜鉛	
	もの	点実現装置であって、日本電気計器	
		検定所が保管するもの	
国立研究開発法人	白金抵抗温度計であって、特定標準器による	温度定点群実現装置であって、国立	
産業技術総合研究所 	校正が行われる温度が660度又は962度	研究開発法人産業技術総合研究所が	
	のもの	保管するもの	
	貴金属熱電対であって、特定標準器による校	温度定点群実現装置であって、国立	
	正が行われる温度が962度、1085度及	研究開発法人産業技術総合研究所が	
	び1554度のもの	保管するもの	
日本電気計器検定所	放射温度計校正用の亜鉛点実現装置、アルミ	放射温度計校正用の亜鉛点実現装	
	ニウム点実現装置、銀点実現装置、銅点実現	置、アルミニウム点実現装置、銀点	
	装置又は単色放射温度計であって、校正範囲	実現装置、銅点実現装置及び単色放	
	が400度以上2000度以下のもの	射温度計であって、日本電気計器検	
	火 佐田 進雨 は ボカー・マー 	定所が保管するもの	
	光度標準電球であって、校正範囲が10カンデー以上3000カンデー以下の1の	コイルM字型光度標準電球であっ	
	デラ以上3000カンデラ以下のもの 	て、日本電気計器検定所が保管する	
		もの	
	全光束標準電球であって、校正範囲が5ルー	全光束標準電球であって、日本電気	
	メン以上20000ルーメン以下のもの	計器検定所が保管するもの	

1		,
	単平面型照度標準電球であって、校正範囲が	単平面型照度標準電球であって、日
	1ルクス以上3000ルクス以下のもの	本電気計器検定所が保管するもの
	分光放射照度標準電球であって、校正範囲が	分光放射照度標準電球であって、日
	250ナノメートル以上2500ナノメート	本電気計器検定所が保管するもの
	ル以下のもの	
	分布温度標準電球であって、校正範囲が20	コイルM字型分布温度標準電球であ
	00ケルビン以上3000ケルビン以下のも	って、日本電気計器検定所が保管す
	Ø	るもの
国立研究開発法人	分光応答度校正用のシリコンフォトダイオー	単色平行光発生装置、比較受光器及
産業技術総合研究所	ドであって、校正範囲が波長において200	び自己校正測定装置であって、国立
	ナノメートル以上1150ナノメートル以下	研究開発法人産業技術総合研究所が
	のもの及び分光応答度校正用のインジウムガ	保管するもの
	リウムひ素フォトダイオードであって、校正	
	範囲が波長において800ナノメートル以上	
	1650ナノメートル以下のもの	
	ロータリエンコーダ	角度測定装置であって、国立研究開
		発法人産業技術総合研究所が保管す
		るもの
	気体流量校正装置であって、校正範囲が 0.	気体流量校正設備であって、国立研
	005グラム毎分以上180グラム毎分以下	究開発法人産業技術総合研究所が保
	のもの又はISO型トロイダルスロート音速	管するもの
	ノズルであって、校正範囲が0.005グラ	
	ム毎分以上20キログラム毎分以下のもの	
	液体流量校正装置であって、校正範囲が 0.	液体流量校正設備であって、国立研
	3立方メートル毎時以上3000立方メート	究開発法人産業技術総合研究所が保
	ル毎時以下のもの	管するもの
	石油用流量計であって、校正範囲が3立方メ	石油用流量校正設備であって、国立
	ートル毎時以上300立方メートル毎時以下	研究開発法人産業技術総合研究所が
	のもの又は、0.67キログラム毎秒以上6	保管するもの
	フキログラム毎秒以下のもの	
	レーザ流速計であって、校正範囲が1.3メ	気体流速校正設備であって、国立研
	ートル毎秒以上40メートル毎秒以下のも	 究開発法人産業技術総合研究所が保
	の、微風速校正風洞であって、校正範囲が	管するもの
	O. 0 5 メートル毎秒以上1. 5 メートル毎	
	砂以下のもの又は超音波流速計であって、校	
	正範囲が0.05メートル毎秒以上40メー	
	トル毎秒以下のもの	
		レーザ干渉式振動測定装置であっ
	であって、校正範囲が1ヘルツ以上5キロへ	て、国立研究開発法人産業技術総合
	ルツ以下のもの	研究所が保管するもの
1		31701/10 KP D 7 0 0 0 0 0

	ジョセフソン効果電圧測定装置、電圧測定装	ジョセフソン効果電圧測定装置であ
	置又は電圧発生装置であって、校正範囲が 1	って、国立研究開発法人産業技術総
	ボルト以上10ボルト以下のものであり、か	合研究所が保管するもの
	つ、精度が0.5ピーピーエム又はより高い	
	もの	
日本電気計器検定所	電圧発生装置又は電圧測定装置であって、校	ジョセフソン効果電圧測定装置、電
	正範囲が1ボルト以上10ボルト以下のもの	圧発生装置及び電圧比測定装置であ
	であり、かつ、精度が0.5ピーピーエムよ	って日本電気計器検定所が保管する
	り低いもの	もの
	標準分圧器であって、校正範囲が100キロ	標準分圧器であって、日本電気計器
	ボルト以下のもの	検定所が保管するもの
国立研究開発法人	標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正	量子ホール効果抵抗測定装置であっ
産業技術総合研究所	範囲が1オーム以上10キロオーム以下のも	て、国立研究開発法人産業技術総合
	のであり、かつ、精度がO.5ピーピーエム	研究所が保管するもの
	又はより高いもの	
日本電気計器検定所	標準抵抗器又は抵抗測定装置であって、校正	標準抵抗器及び抵抗比測定装置であ
	範囲が1ミリオーム以上100キロオーム以	って、日本電気計器検定所が保管す
	下のものであり、かつ、精度が0. 5ピーピ	るもの
	ーエムより低いもの	
国立研究開発法人	標準抵抗器であって、校正範囲が1メガオー	量子ホール効果抵抗測定装置であっ
産業技術総合研究所	ム以上 1 テラオーム以下のもの	て、国立研究開発法人産業技術総合
		研究所が保管するもの
日本電気計器検定所	電流発生装置、電圧発生装置、電圧測定装	電圧発生装置及び標準抵抗器であっ
	置、標準分流器又は標準抵抗器であって、校	て、日本電気計器検定所が保管する
	正範囲が100アンペア以下のもの	もの
	交流電圧発生装置、交流電圧測定装置又は交	交流電圧用及び交流電流用交直変換
	直電圧比較装置であって、校正範囲が 1 メガ	器並びに交直差測定装置であって、
	ヘルツ以下及び1キロボルト以下のもの	日本電気計器検定所が保管するもの
国立研究開発法人	誘導分圧器であって、周波数が1キロヘルツ	誘導分圧器校正装置であって、国立
産業技術総合研究所	の場合において、校正範囲が10ボルトのも	研究開発法人産業技術総合研究所が
	の又は周波数が50ヘルツ以上60ヘルツ以	保管するもの
	下の場合において、校正範囲が100ボルト	
	のもの	
日本電気計器検定所	交流電流発生装置、交流電流測定装置又は交	交流電圧用及び交流電流用交直変換
	直電流比較装置であって、周波数が45ヘル	器並びに交直差測定装置であって、
	ツ以上65ヘルツ以下の場合において、校正	日本電気計器検定所が保管するもの
	範囲が20アンペア以下のもの	
	電力変換器又は電力測定装置であって、周波	電力電力量校正装置であって、日本
	数が45ヘルツ以上65ヘルツ以下の場合に	電気計器検定所が保管するもの
	おいて、校正範囲が110ボルト以下及び5	
	0アンペア以下のもの	
		·

I	<u> </u>	1
	電力量測定装置であって、周波数が45ヘル	
	ツ以上65ヘルツ以下の場合において、校正	
	範囲が110ボルト以下及び5アンペア以下	
	のもの	
国立研究開発法人	キャパシタであって、周波数が1592ヘル	キャパシタンス測定装置であって、
産業技術総合研究所	ツの場合において、静電容量が10ピコファ	国立研究開発法人産業技術総合研究
	ラド、100ピコファラド又は1000ピコ	所が保管するもの
	ファラドのもの	
	交流抵抗器であって、周波数が 1 キロヘルツ	交流抵抗測定装置であって、国立研
	の場合において、抵抗値が10キロオームの	究開発法人産業技術総合研究所が保
	もの	管するもの
	電圧測定装置であって、電圧が 0. 5 ボルト	サーミスタ式電圧測定装置であっ
	 の場合において、校正範囲が10メガヘルツ	て、国立研究開発法人産業技術総合
	 以上 1 ギガヘルツ以下のもの	研究所が保管するもの
	├── 「電力測定装置であって、線路が7ミリメート	カロリーメータ方式電力測定装置で
	レ同軸及び電力が1ミリワットの場合におい	あって、国立研究開発法人産業技術
	て、校正範囲が10メガヘルツ以上18ギガ	総合研究所が保管するもの
	ヘルツ以下のもの又は線路が2.9ミリメー	
	 トル同軸及び電力が1ミリワットの場合にお	
	いて、校正範囲が10メガヘルツ以上40ギ	
	ガヘルツ以下のもの又は線路が2.9ミリメ	
	ートル同軸及び電力が10ミリワットの場合	
	において、校正範囲が10メガヘルツ以上4	
	0ギガヘルツ以下のもの	
	レーザビーム用熱型光パワー測定装置であっ	カロリーメータ方式レーザパワー測
	て、波長が488ナノメートル又は515ナ	定装置であって、国立研究開発法人
	ノメートルの場合においては、校正範囲が 1	産業技術総合研究所が保管するもの
	0ミリワット以上200ミリワット以下、6	
	33ナノメートルの場合においては、校正範	
	囲が50マイクロワット以上10ミリワット	
	以下若しくは1550ナノメートルの場合に	
	おいては、校正範囲が50マイクロワット以	
	上1ミリワット以下のもの	
	高周波雑音発生装置であって、周波数が2ギ	高周波雑音測定装置であって、国立
	ガヘルツ以上18ギガヘルツ以下の場合にお	研究開発法人産業技術総合研究所が
	いて、校正範囲が150ケルビン以上120	保管するもの
	00ケルビン以下のもの	火港寺見別点サポッキュー ロナザ
	光電検出器であって、波長が1550ナノメ	光減衰量測定装置であって、国立研究は大きな
	一トル及び電力が1ミリワットの場合におい	究開発法人産業技術総合研究所が保
	て、校正範囲が9デシベル以上90デシベル 。	管するもの
	以下のもの	

	ピストン減衰器であって、周波数が30メガ	高周波減衰量測定装置であって、国
	ヘルツの場合において、校正範囲が100デ	立研究開発法人産業技術総合研究所
	シベル以下のもの又は可変減衰器であって、	が保管するもの
	周波数が10メガヘルツ以上12ギガヘルツ	
	以下の場合において、校正範囲が100デシ	
	ベル以下のもの若しくは周波数が12ギガへ	
	ルツを超え40ギガヘルツ以下の場合におい	
	て、校正範囲が60デシベル以下のもの	
	固定長エレメント型のダイポールアンテナで	標準アンテナ群であって、国立研究
	あって、周波数が30メガヘルツ以上1ギガ	開発法人産業技術総合研究所が保管
	ヘルツ以下のもの	するもの
	シリコン単結晶であって、校正範囲が232	単結晶シリコン球体であって、国立
	O キログラム毎立方メートル以上2340キ	研究開発法人産業技術総合研究所が
	ログラム毎立方メートル以下のもの	保管するもの
	実荷重式、こうかん式、油圧式又はビルドア	実荷重式、こうかん式及び油圧式力
	ップ式力基準機であって、校正範囲が圧縮力	標準機群であって、国立研究開発法
	にあっては10ニュートン以上10メガニュ	人産業技術総合研究所が保管するも
	ートン以下のもの、引張力にあっては10二	Ø
	ュートン以上1メガニュートン以下のもの	
	参照用トルクメータであって、校正範囲が 5	トルク標準機群であって、国立研究
	ニュートンメートル以上20キロニュートン	開発法人産業技術総合研究所が保管
	メートル以下のもの又は参照用トルクレンチ	するもの
	であって、校正範囲が5ニュートンメートル	
	以上 1 キロニュートンメートル以下のもの	
	ピストン式重錘型圧力標準器であって、校正	光波干渉式標準圧力計及びピストン
	範囲が気体にあっては5キロパスカル以上7	式一次圧力標準器群であって、国立
	メガパスカル以下のもの、液体にあっては 1	研究開発法人産業技術総合研究所が
	メガパスカル以上500メガパスカル以下の	保管するもの
	もの	
	粘性真空計であって、校正範囲が1ミリパス	中真空標準装置であって、国立研究
	カル以上 1 パスカル以下のもの	開発法人産業技術総合研究所が保管
		するもの
一般財団法人	熱量標準安息香酸	熱量標準安息香酸であって、一般財
日本品質保証機構		団法人日本品質保証機構が保管する
		精密天びん及び精密熱量測定装置を
		用いて製造されたもの
国立研究開発法人	I 形標準マイクロホンであって、校正周波数	標準マイクロホン音圧相互校正装置
産業技術総合研究所	範囲が20ヘルツ以上12500ヘルツ以下	であって、国立研究開発法人産業技
	又はⅡ形標準マイクロホンであって、校正周	術総合研究所が保管するもの
	波数範囲が20ヘルツ以上2000ヘルツ	
	以下のもの	
		·

一般財団法人化学物	メタン標準ガスのうち空気希釈のものであっ	メタン標準ガスであって、一般財団
質評価研究機構	て、濃度が1体積百万分率以上50体積百万	法人化学物質評価研究機構が保管す
	分率以下のもの	る標準ガス製造用精密天びん、標準
		ガス調整装置及び分析計測装置(以
		下「標準ガス製造装置」という。)
		を用いて製造されたもの
	プロパン標準ガスのうち空気希釈のものであ	プロパン標準ガスであって、一般財
	って、濃度が3.5体積百万分率以上500	団法人化学物質評価研究機構が保管
	体積百万分率以下のもの又は窒素希釈のもの	する標準ガス製造装置を用いて製造
	であって、濃度が150体積百万分率以上	されたもの
	1. 5体積百分率以下のもの	
	一酸化炭素標準ガスのうち窒素希釈のもので	一酸化炭素標準ガスであって、一般
	あって、濃度が3体積百万分率以上15体積	財団法人化学物質評価研究機構が保
	百分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製
		造されたもの
	二酸化炭素標準ガスのうち窒素希釈のもので	二酸化炭素標準ガスであって、一般
	あって、濃度が3体積百万分率以上16体積	財団法人化学物質評価研究機構が保
	百分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製
		造されたもの
	一酸化窒素標準ガスのうち窒素希釈のもので	一酸化窒素標準ガスであって、一般
	あって、濃度が0.05体積百万分率以上5	財団法人化学物質評価研究機構が保
	体積百分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製
		造されたもの
	二酸化窒素標準ガスのうち空気希釈のもので	二酸化窒素標準ガスであって、一般
	あって、濃度が5体積百万分率以上50体積	財団法人化学物質評価研究機構が保
	百万分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製
		造されたもの
	酸素標準ガスのうち窒素希釈のものであっ	酸素標準ガスであって、一般財団法
	て、濃度が1体積百分率以上25体積百分率	人化学物質評価研究機構が保管する
	以下及び濃度が98体積百分率以上100体	標準ガス製造装置を用いて製造され
	積百分率以下のもの	たもの
	二酸化硫黄標準ガスのうち窒素希釈のもので	二酸化硫黄標準ガスであって、一般
	あって、濃度が〇. 1体積百万分率以上1体	財団法人化学物質評価研究機構が保
	積百分率以下のもの及び空気希釈のものであ	管する標準ガス製造装置を用いて製
	って、濃度が0.05体積百万分率以上0.	造されたもの
	1体積百万分率以下のもの	
	アンモニア標準ガスのうち窒素希釈のもので	アンモニア標準ガスであって、一般
	あって、濃度が20体積百万分率以上100	財団法人化学物質評価研究機構が保
	体積百万分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製

造されたもの

ジクロロメタン標準ガスのうち窒素希釈のも	ジクロロメタン標準ガスであって、
のであって、濃度が0. 1体積百万分率以上	一般財団法人化学物質評価研究機構
1体積百万分率以下のもの	が保管する標準ガス製造装置を用い
	て製造されたもの
クロロホルム標準ガスのうち窒素希釈のもの	クロロホルム標準ガスであって、一
であって、濃度が 0. 1体積百万分率以上 1	般財団法人化学物質評価研究機構が
体積百万分率以下のもの	保管する標準ガス製造装置を用いて
	製造されたもの
トリクロロエチレン標準ガスのうち窒素希釈	トリクロロエチレン標準ガスであっ
のものであって、濃度が0.1体積百万分率	て、一般財団法人化学物質評価研究
以上1体積百万分率以下のもの	機構が保管する標準ガス製造装置を
	用いて製造されたもの
テトラクロロエチレン標準ガスのうち窒素希	テトラクロロエチレン標準ガスであ
釈のものであって、濃度が0. 1体積百万分	って、一般財団法人化学物質評価研
率以上1体積百万分率以下のもの	究機構が保管する標準ガス製造装置
	を用いて製造されたもの
1, 2-ジクロロエタン標準ガスのうち窒素	1, 2-ジクロロエタン標準ガスで
希釈のものであって、濃度が O. 1体積百万	あって、一般財団法人化学物質評価
分率以上1体積百万分率以下のもの	研究機構が保管する標準ガス製造装
	置を用いて製造されたもの
ベンゼン標準ガスのうち窒素希釈のものであ	ベンゼン標準ガスであって、一般財
って、濃度が 0. 1体積百万分率以上 1体積	団法人化学物質評価研究機構が保管
百万分率以下のもの	する標準ガス製造装置を用いて製造
	されたもの
1, 3-ブタジエン標準ガスのうち窒素希釈	1, 3ーブタジエン標準ガスであっ
のものであって、濃度が0.1体積百万分率	て、一般財団法人化学物質評価研究
以上1体積百万分率以下のもの	機構が保管する標準ガス製造装置を
	用いて製造されたもの
アクリロニトリル標準ガスのうち窒素希釈の	アクリロニトリル標準ガスであっ
ものであって、濃度が0.1体積百万分率以	て、一般財団法人化学物質評価研究
上1体積百万分率以下のもの	機構が保管する標準ガス製造装置を
	用いて製造されたもの
塩化ビニル標準ガスのうち窒素希釈のもので	塩化ビニル標準ガスであって、一般
あって、濃度が0.1体積百万分率以上1体	財団法人化学物質評価研究機構が保
積百万分率以下のもの	管する標準ガス製造装置を用いて製
	造されたもの
o-キシレン標準ガスのうち窒素希釈のもの	<i>o</i> − キシレン標準ガスであって、−
であって、濃度が 0. 1体積百万分率以上 1	般財団法人化学物質評価研究機構が
体積百万分率以下のもの	保管する標準ガス製造装置を用いて
	製造されたもの

mーキシレン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が 0. 1体積百万分率以上 1体積百万分率以下のもの

mーキシレン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて 製造されたもの

トルエン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が O. 1体積百万分率以上 1体積百万分率以下のもの

トルエン標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準ガス製造装置を用いて製造されたもの

エチルベンゼン標準ガスのうち窒素希釈のものであって、濃度が O. 1体積百万分率以上1体積百万分率以下のもの

エチルベンゼン標準ガスであって、 一般財団法人化学物質評価研究機構 が保管する標準ガス製造装置を用い て製造されたもの

空気の零位調整標準ガス又は窒素の零位調整標準ガスであって、メタン濃度が 0. 1体積百万分率以下、一酸化炭素濃度が 0. 1体積百万分率以下、二酸化炭素濃度が 0. 1体積百万分率以下、窒素酸化物濃度が 0. 005体積百万分率以下及び二酸化硫黄濃度が 0.05体積百万分率以下のもの

空気の零位調整標準ガス及び窒素の 零位調整標準ガスであって、一般財 団法人化学物質評価研究機構が保管 する標準ガス製造装置を用いて製造 されたもの

窒素の零位調整標準ガスであって、ベンゼン 濃度が 0.05体積十億分率以下、トリクロ ロエチレン濃度が 0.01体積十億分率以 下、テトラクロロエチレン濃度が 0.01体 積十億分率以下、クロホルム濃度が 0.0が 1体積十億分率以下、ジクロメタン濃度が 0.0が ロエタン濃度が 0.01体積十億分率以下、億 カーエタン濃度が 0.01体積十億分率以下、億 分率以下、塩化ビニル濃度が 0.0 1体積十億分率以下、エチルベンゼン濃度が 0.0 1体積十億分率以下、エチルベンゼン濃度が 0.0 1体積十億分率以下、アクリーキシレン濃度が 0.0 1体積十億分率以下 0.0 1体積十億分率以下 0.0 1体積十億分率以下 0.0

窒素の揮発性有機化合物測定用零位 調整標準ガスであって、一般財団法 人化学物質評価研究機構が保管する 標準ガス製造装置を用いて製造され たもの

窒素の零位調整標準ガスであって、一酸化窒素濃度が O. 1体積十億分率以下のもの

レン濃度が0.01体積十億分率以下のもの

窒素の低濃度窒素酸化物測定用零位 調整標準ガスであって、一般財団法 人化学物質評価研究機構が保管する 標準ガス製造装置を用いて製造され たもの

空気の零位調整標準ガスであって、二酸化硫 黄濃度が O. 2体積十億分率以下のもの 空気の低濃度二酸化硫黄測定用零位 調整標準ガスであって、一般財団法

人化学物質評価研究機構が保管する 標準ガス製造装置を用いて製造され たもの エタノール標準ガスのうち窒素希釈のもので エタノール標準ガスであって、一般 あって、濃度が100体積百万分率以上50 財団法人化学物質評価研究機構が保 0 体積百万分率以下のもの及び空気希釈のも 管する標準ガス製造装置を用いて製 のであって、濃度が100体積百万分率以上 造されたもの 500体積百万分率以下のもの 揮発性有機化合物 9 種混合標準ガスのうち窒 揮発性有機化合物9種混合標準ガス 素希釈のものであって、ジクロロメタン、ク であって、一般財団法人化学物質評 ロロホルム、塩化ビニル、1、2-ジクロロ 価研究機構が保管する標準ガス製造 エタン、テトラクロロエチレン、トリクロロ 装置を用いて製造されたもの エチレン、アクリロニトリル、1,3ーブタ ジェン及びベンゼンの各濃度が同一、かつ、 0. 1体積百万分率以上1体積百万分率以下 のもの ベンゼン等5種混合標準ガスのうち窒素希釈 ベンゼン等5種混合標準ガスであっ のものであって、ベンゼン、トルエン、ゥー て、一般財団法人化学物質評価研究 キシレン、*m*-キシレン及びエチルベンゼン 機構が保管する標準ガス製造装置を の各濃度が同一、かつ、0.1体積百万分率 用いて製造されたもの 以上1体積百万分率以下のもの しゅう酸塩ピーエッチ標準液、フタル酸塩ピ しゅう酸塩ピーエッチ標準液、フタ ーエッチ標準液、中性りん酸塩ピーエッチ標 ル酸塩ピーエッチ標準液、中性りん 準液、りん酸塩ピーエッチ標準液、ほう酸塩 酸塩ピーエッチ標準液、りん酸塩ピ ピーエッチ標準液又は炭酸塩ピーエッチ標準 ーエッチ標準液、ほう酸塩ピーエッ 液 チ標準液及び炭酸塩ピーエッチ標準 液であって、一般財団法人化学物質 評価研究機構が保管する標準液製造 用精密天びん、超純水製造装置及び 分析計測装置(以下「標準液製造装 置」という。)を用いて製造された もの アルミニウム標準液であって、濃度が1ミリ アルミニウム標準液であって、一般 グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以 財団法人化学物質評価研究機構が保 下のもの 管する標準液製造装置を用いて製造 されたもの ひ素標準液であって、濃度が1ミリグラム毎 ひ素標準液であって、一般財団法人 リットル以上 1 グラム毎リットル以下のもの 化学物質評価研究機構が保管する標 準液製造装置を用いて製造されたも ഗ

ビスマス標準液であって、濃度が1ミリグラ	ビスマス標準液であって、一般財団
ム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下の	法人化学物質評価研究機構が保管す
もの	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
カルシウム標準液であって、濃度が1ミリグ	カルシウム標準液であって、一般財
ラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下	団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
カドミウム標準液であって、濃度が1ミリグ	カドミウム標準液であって、一般財
ラム毎リットル以上1グラム毎リットル以下	団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
 コバルト標準液であって、濃度が1ミリグラ	コバルト標準液であって、一般財団
 ム毎リットル以上1グラム毎リットル以下の	 法人化学物質評価研究機構が保管す
もの	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
 クロム標準液であって、濃度が1ミリグラム	クロム標準液であって、一般財団法
毎リットル以上1グラム毎リットル以下のも	人化学物質評価研究機構が保管する
O	標準液製造装置を用いて製造された
	もの
銅標準液であって、濃度が1ミリグラム毎リ	銅標準液であって、一般財団法人化
ットル以上1グラム毎リットル以下のもの	学物質評価研究機構が保管する標準
	液製造装置を用いて製造されたもの
鉄標準液であって、濃度が1ミリグラム毎リ	鉄標準液であって、一般財団法人化
ットル以上1グラム毎リットル以下のもの	学物質評価研究機構が保管する標準
	液製造装置を用いて製造されたもの
水銀標準液であって、濃度が1ミリグラム毎	水銀標準液であって、一般財団法人
リットル以上1グラム毎リットル以下のもの	化学物質評価研究機構が保管する標
	準液製造装置を用いて製造されたも
	_σ
カリウム標準液であって、濃度が1ミリグラ	カリウム標準液であって、一般財団
ム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下の	法人化学物質評価研究機構が保管す
もの	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
マグネシウム標準液であって、濃度が1ミリ	マグネシウム標準液であって、一般
グラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以	財団法人化学物質評価研究機構が保
下のもの	管する標準液製造装置を用いて製造
	されたもの
マンガン標準液であって、濃度が1ミリグラ	マンガン標準液であって、一般財団
ム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下の	法人化学物質評価研究機構が保管す
もの	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
<u> </u>	1

ナトリウム標準液であって、濃度が1ミリグ	ナトリウム標準液であって、一般財
ラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下	団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
ニッケル標準液であって、濃度が1ミリグラ	ニッケル標準液であって、一般財団
ム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下の	法人化学物質評価研究機構が保管す
もの	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
鉛標準液であって、濃度が1ミリグラム毎リ	鉛標準液であって、一般財団法人化
ットル以上 1 グラム毎リットル以下のもの	学物質評価研究機構が保管する標準
	液製造装置を用いて製造されたもの
アンチモン標準液であって、濃度が1ミリグ	アンチモン標準液であって、一般財
ラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下	団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
亜鉛標準液であって、濃度が1ミリグラム毎	亜鉛標準液であって、一般財団法人
リットル以上 1 グラム毎リットル以下のもの	化学物質評価研究機構が保管する標
	準液製造装置を用いて製造されたも
	Ø
バリウム標準液であって、濃度が1グラム毎	バリウム標準液であって、一般財団
リットルのもの	法人化学物質評価研究機構が保管す
	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
リチウム標準液であって、濃度が 1 グラム毎	リチウム標準液であって、一般財団
リットルのもの	法人化学物質評価研究機構が保管す
	る標準液製造装置を用いて製造され
	たもの
モリブデン標準液であって、濃度が1グラム	モリブデン標準液であって、一般財
毎リットルのもの	団法人化学物質評価研究機構が保管
	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
セレン標準液であって、濃度が 1 グラム毎リ	セレン標準液であって、一般財団法
ットルのもの	人化学物質評価研究機構が保管する
	標準液製造装置を用いて製造された
	もの
すず標準液であって、濃度が1グラム毎リッ	すず標準液であって、一般財団法人
トルのもの	化学物質評価研究機構が保管する標
	準液製造装置を用いて製造されたも
	Ø
ストロンチウム標準液であって、濃度が1グ	ストロンチウム標準液であって、一
ラム毎リットルのもの	般財団法人化学物質評価研究機構が

	保管する標準液製造装置を用いて製
	造されたもの
 タリウム標準液であって、濃度が1グラム毎	タリウム標準液であって、一般財団
リットルのもの	法人化学物質評価研究機構が保管す
1 9 5 700 600	
	る標準液製造装置を用いて製造され
11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、	たもの
ルビジウム標準液であって、濃度が1グラム	ルビジウム標準液であって、一般財
毎リットルのもの 	団法人化学物質評価研究機構が保管
	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
塩化物イオン標準液であって、濃度が1ミリ	塩化物イオン標準液であって、一般
グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以	財団法人化学物質評価研究機構が保
下のもの	管する標準液製造装置を用いて製造
	されたもの
ふっ化物イオン標準液であって、濃度が1ミ	ふっ化物イオン標準液であって、一
リグラム毎リットル以上1グラム毎リットル	般財団法人化学物質評価研究機構が
以下のもの	保管する標準液製造装置を用いて製
	造されたもの
亜硝酸イオン標準液であって、濃度が1ミリ	亜硝酸イオン標準液であって、一般
グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以	財団法人化学物質評価研究機構が保
下のもの	管する標準液製造装置を用いて製造
	されたもの
硝酸イオン標準液であって、濃度が1ミリグ	硝酸イオン標準液であって、一般財
ラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以下	団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
りん酸イオン標準液であって、濃度が1ミリ	りん酸イオン標準液であって、一般
グラム毎リットル以上 1 グラム毎リットル以	財団法人化学物質評価研究機構が保
下のもの	管する標準液製造装置を用いて製造
	されたもの
 硫酸イオン標準液であって、濃度が1ミリグ	硫酸イオン標準液であって、一般財
 ラム毎リットル以上1グラム毎リットル以下	 団法人化学物質評価研究機構が保管
のもの	する標準液製造装置を用いて製造さ
	れたもの
	アンモニウムイオン標準液であっ
1ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リッ	て、一般財団法人化学物質評価研究
トル以下のもの	機構が保管する標準液製造装置を用
	いて製造されたもの
 シアン化物イオン標準液であって、濃度が 1	シアン化物イオン標準液であって、
グラム毎リットルのもの	一般財団法人化学物質評価研究機構
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	が保管する標準液製造装置を用いて
	が休官する標準放表追表直を用いて 製造されたもの
	衣担でイルにもい

臭化物イオン標準液であって、濃度が1グラ 臭化物イオン標準液であって、一般 ム毎リットルのもの 財団法人化学物質評価研究機構が保 管する標準液製造装置を用いて製造 されたもの ジクロロメタン標準液のうちヘキサン希釈の ジクロロメタン標準液であって、一 ものであって、濃度が100ミリグラム毎リ 般財団法人化学物質評価研究機構が ットル以上 1 グラム毎リットル以下のもの及 保管する標準液製造用精密天びん及 びメタノール希釈のものであって、濃度が1 び分析計測装置(以下「有機標準液 00ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リ 製造装置」という。)を用いて製造 されたもの ットル以下のもの クロロホルム標準液のうちヘキサン希釈のも クロロホルム標準液であって、一般 のであって、濃度が100ミリグラム毎リッ 財団法人化学物質評価研究機構が保 トル以上1グラム毎リットル以下のもの及び 管する有機標準液製造装置を用いて メタノール希釈のものであって、濃度が10 製造されたもの 0ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リッ トル以下のもの 四塩化炭素標準液のうちヘキサン希釈のもの 四塩化炭素標準液であって、一般財 であって、濃度が100ミリグラム毎リット 団法人化学物質評価研究機構が保管 ル以上1グラム毎リットル以下のもの及びメ する有機標準液製造装置を用いて製 タノール希釈のものであって、濃度が100 造されたもの ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リット ル以下のもの トリクロロエチレン標準液のうちヘキサン希 トリクロロエチレン標準液であっ 釈のものであって、濃度が100ミリグラム て、一般財団法人化学物質評価研究 毎リットル以上1グラム毎リットル以下のも 機構が保管する有機標準液製造装置 の及びメタノール希釈のものであって、濃度 を用いて製造されたもの が100ミリグラム毎リットル以上1グラム 毎リットル以下のもの テトラクロロエチレン標準液のうちヘキサン テトラクロロエチレン標準液であっ 希釈のものであって、濃度が100ミリグラ て、一般財団法人化学物質評価研究 ム毎リットル以上1グラム毎リットル以下の 機構が保管する有機標準液製造装置 もの及びメタノール希釈のものであって、濃 を用いて製造されたもの 度が100ミリグラム毎リットル以上1グラ ム毎リットル以下のもの 1. 2 - ジクロロエタン標準液のうちヘキサ 1, 2-ジクロロエタン標準液であ ン希釈のものであって、濃度が100ミリグ って、一般財団法人化学物質評価研 ラム毎リットル以上1グラム毎リットル以下 究機構が保管する有機標準液製造装 のもの及びメタノール希釈のものであって、 置を用いて製造されたもの 濃度が100ミリグラム毎リットル以上1グ ラム毎リットル以下のもの

1, 1 - ジクロロエチレン標準液のうちへキ 1, 1 - ジクロロエチレン標準液でサン希釈のものであって、濃度が 1 O O ミリ あって、一般財団法人化学物質評価

グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以 研究機構が保管する有機標準液製造 下のもの及びメタノール希釈のものであっ 装置を用いて製造されたもの て、濃度が100ミリグラム毎リットル以上 1グラム毎リットル以下のもの cis-1. 2-ジクロロエチレン標準液の cis-1, 2-i00うちヘキサン希釈のものであって、濃度が 1 標準液であって、一般財団法人化学 00ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リ 物質評価研究機構が保管する有機標 準液製造装置を用いて製造されたも ットル以下のもの及びメタノール希釈のもの であって、濃度が100ミリグラム毎リット ル以上1グラム毎リットル以下のもの 1. 1. 1ートリクロロエタン標準液のうち 1. 1. 1ートリクロロエタン標準 ヘキサン希釈のものであって、濃度が100 液であって、一般財団法人化学物質 ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リット 評価研究機構が保管する有機標準液 製造装置を用いて製造されたもの ル以下のもの及びメタノール希釈のものであ って、濃度が100ミリグラム毎リットル以 上1グラム毎リットル以下のもの 1. 1. 2ートリクロロエタン標準液のうち 1. 1. 2ートリクロロエタン標準 ヘキサン希釈のものであって、濃度が100 液であって、一般財団法人化学物質 ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リット 評価研究機構が保管する有機標準液 ル以下のもの及びメタノール希釈のものであ 製造装置を用いて製造されたもの って、濃度が100ミリグラム毎リットル以 上1グラム毎リットル以下のもの t rans-1, 3-ジクロロプロペン標準 t rans-1, 3-ジクロロプロ液のうちヘキサン希釈のものであって、濃度 ペン標準液であって、一般財団法人 が100ミリグラム毎リットル以上1グラム 化学物質評価研究機構が保管する有 毎リットル以下のもの及びメタノール希釈の 機標準液製造装置を用いて製造され ものであって、濃度が100ミリグラム毎リ たもの ットル以上1グラム毎リットル以下のもの c i s-1, 3-ジクロロプロペン標準液のうちヘキサン希釈のものであって、濃度が1 標準液であって、一般財団法人化学 00ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リ 物質評価研究機構が保管する有機標 ットル以下のもの及びメタノール希釈のもの 準液製造装置を用いて製造されたも であって、濃度が100ミリグラム毎リット ഗ ル以上1グラム毎リットル以下のもの ベンゼン標準液のうちヘキサン希釈のもので ベンゼン標準液であって、一般財団 あって、濃度が100ミリグラム毎リットル 法人化学物質評価研究機構が保管す 以上1グラム毎リットル以下のもの及びメタ る有機標準液製造装置を用いて製造 ノール希釈のものであって、濃度が100ミ されたもの リグラム毎リットル以上1グラム毎リットル 以下のもの トルエン標準液のうちヘキサン希釈のもので トルエン標準液であって、一般財団 あって、濃度が100ミリグラム毎リットル

|法人化学物質評価研究機構が保管す

以上1グラム毎リットル以下のもの及びメタ ノール希釈のものであって、濃度が100ミ リグラム毎リットル以上1グラム毎リットル 以下のもの

る有機標準液製造装置を用いて製造 されたもの

o-キシレン標準液のうちヘキサン希釈のも のであって、濃度が100ミリグラム毎リッ トル以上 1 グラム毎リットル以下のもの及び メタノール希釈のものであって、濃度が10 0ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リッ トル以下のもの

o-キシレン標準液であって、一般 財団法人化学物質評価研究機構が保 管する有機標準液製造装置を用いて 製造されたもの

m-キシレン標準液のうちヘキサン希釈のも のであって、濃度が100ミリグラム毎リッ トル以上1グラム毎リットル以下のもの及び メタノール希釈のものであって、濃度が10 0ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リッ トル以下のもの

m-キシレン標準液であって、一般 財団法人化学物質評価研究機構が保 管する有機標準液製造装置を用いて 製造されたもの

p-キシレン標準液のうちヘキサン希釈のも のであって、濃度が100ミリグラム毎リッ トル以上1グラム毎リットル以下のもの及び メタノール希釈のものであって、濃度が10 0ミリグラム毎リットル以上1グラム毎リッ トル以下のもの

p-キシレン標準液であって、一般 財団法人化学物質評価研究機構が保 管する有機標準液製造装置を用いて 製造されたもの

トリブロモメタン標準液のうちヘキサン希釈 のものであって、濃度が100ミリグラム毎 リットル以上 1 グラム毎リットル以下のもの 及びメタノール希釈のものであって、濃度が 100ミリグラム毎リットル以上1グラム毎 リットル以下のもの

トリブロモメタン標準液であって、 一般財団法人化学物質評価研究機構 が保管する有機標準液製造装置を用 いて製造されたもの

ブロモジクロロメタン標準液のうちヘキサン 希釈のものであって、濃度が100ミリグラ ム毎リットル以上1グラム毎リットル以下の もの及びメタノール希釈のものであって、濃 度が100ミリグラム毎リットル以上1グラ ム毎リットル以下のもの

ブロモジクロロメタン標準液であっ て、一般財団法人化学物質評価研究 機構が保管する有機標準液製造装置 を用いて製造されたもの

ジブロモクロロメタン標準液のうちヘキサン 希釈のものであって、濃度が100ミリグラ ム毎リットル以上1グラム毎リットル以下の もの及びメタノール希釈のものであって、濃 度が100ミリグラム毎リットル以上1グラ ム毎リットル以下のもの

ジブロモクロロメタン標準液であっ て、一般財団法人化学物質評価研究 機構が保管する有機標準液製造装置 を用いて製造されたもの

trans-1, 2-ジクロロエチレン標準 液のうちヘキサン希釈のものであって、濃度 レン標準液であって、一般財団法人

t rans-1, 2-ジクロロエチ

が100ミリグラム毎リットル以上1グラム 化学物質評価研究機構が保管する有 毎リットル以下のもの及びメタノール希釈の 機標準液製造装置を用いて製造され ものであって、濃度が100ミリグラム毎リ たもの ットル以上1グラム毎リットル以下のもの 1. 2 - ジクロロプロパン標準液のうちへキ 1. 2-ジクロロプロパン標準液で サン希釈のものであって、濃度が100ミリ あって、一般財団法人化学物質評価 グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以 研究機構が保管する有機標準液製造 下のもの及びメタノール希釈のものであっ 装置を用いて製造されたもの て、濃度が100ミリグラム毎リットル以上 1グラム毎リットル以下のもの 1. 4 - ジクロロベンゼン標準液のうちへキ 1. 4 - ジクロロベンゼン標準液で サン希釈のものであって、濃度が100ミリ あって、一般財団法人化学物質評価 グラム毎リットル以上1グラム毎リットル以 研究機構が保管する有機標準液製造 下のもの及びメタノール希釈のものであっ 装置を用いて製造されたもの て、濃度が100ミリグラム毎リットル以上 1グラム毎リットル以下のもの フタル酸ジエチル標準液のうちヘキサン希釈 フタル酸ジエチル標準液であって、 のものであって、濃度が 1 グラム毎リットル 一般財団法人化学物質評価研究機構 のもの及びメタノール希釈のものであって、 が保管する有機標準液製造装置を用 濃度が1グラム毎リットルのもの いて製造されたもの フタル酸ジー nーブチル標準液のうちへキサ フタル酸ジー*n*ーブチル標準液であ ン希釈のものであって、濃度が 1 グラム毎リ って、一般財団法人化学物質評価研 ットルのもの及びメタノール希釈のものであ 究機構が保管する有機標準液製造装 って、濃度が1グラム毎リットルのもの 置を用いて製造されたもの フタル酸ジー2ーエチルヘキシル標準液のう フタル酸ジー2ーエチルヘキシル標 ちヘキサン希釈のものであって、濃度が1グ 準液であって、一般財団法人化学物 ラム毎リットルのもの及びメタノール希釈の 質評価研究機構が保管する有機標準 ものであって、濃度が1グラム毎リットルの 液製造装置を用いて製造されたもの もの フタル酸ブチルベンジル標準液のうちヘキサ フタル酸ブチルベンジル標準液であ ン希釈のものであって、濃度が 1 グラム毎リ って、一般財団法人化学物質評価研 ットルのもの及びメタノール希釈のものであ 究機構が保管する有機標準液製造装 って、濃度が1グラム毎リットルのもの 置を用いて製造されたもの 4-t-オクチルフェノール標準液のうちへ 4-t-オクチルフェノール標準液 キサン希釈のものであって、濃度が 1 グラム であって、一般財団法人化学物質評 毎リットルのもの及びメタノール希釈のもの 価研究機構が保管する有機標準液製 であって、濃度が1グラム毎リットルのもの 造装置を用いて製造されたもの 4 - *t* - ブチルフェノール標準液のうちへキ 4-*t*-ブチルフェノール標準液で サン希釈のものであって、濃度が1グラム毎 あって、一般財団法人化学物質評価 リットルのもの及びメタノール希釈のもので 研究機構が保管する有機標準液製造 あって、濃度が1グラム毎リットルのもの 装置を用いて製造されたもの

4-n-ヘプチルフェノール標準液のうちへ キサン希釈のものであって、濃度が 1 グラム 毎リットルのもの及びメタノール希釈のもの であって、濃度が 1 グラム毎リットルのもの ビスフェノールA標準液のうちメタノール希 釈のものであって、濃度が 1 グラム毎リット ルのもの 4-n-ヘプチルフェノール標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

ビスフェノールA標準液であって、 一般財団法人化学物質評価研究機構 が保管する有機標準液製造装置を用 いて製造されたもの

4-n-ノニルフェノール標準液のうちへキ サン希釈のものであって、濃度が 1 グラム毎 リットルのもの及びメタノール希釈のもので あって、濃度が 1 グラム毎リットルのもの 4-n-ノニルフェノール標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

2, 4ージクロロフェノール標準液のうちへ キサン希釈のものであって、濃度が1グラム 毎リットルのもの及びメタノール希釈のもの であって、濃度が1グラム毎リットルのもの 2, 4 ージクロロフェノール標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

揮発性有機化合物 2 3種混合標準液のうちメタノール希釈のものであって、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロホルム、トリブロモメタン、ブロモジクロロメタン、1,2ードリクロロエタン、1,1ージクロロエタン、1,1ージクロロエチレン、たけった。カロロエチレン、カリクロロエチレン、カリクロロプロペン、はではいました。カージクロロプロペン、1,4ージクロロベンゼ

揮発性有機化合物23種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

アルキルフェノール類等 6 種混合標準液のうちメタノール希釈のものであって、2, 4 ー ジクロロフェノール、4-t ーブチルフェノール、4-n ー t ーオクチルフェノール、4-n ー t ー t ー t ー t ルフェノール t の各濃度が t の t

ン、*o*ーキシレン、*m*ーキシレン、*p*ーキシレン、ベンゼン及びトルエンの各濃度が 1 グ

ラム毎リットルのもの

アルキルフェノール類等6種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

アルキルフェノール類等 5 種混合標準液のうちへキサン希釈のものであって、2,4ージクロロフェノール、4ーtーブチルフェノール、4ーtーオクチルフェノール及び4ーnーノニルフェノールの各濃度が100ミリグラム毎リットルのもの

アルキルフェノール類等 5 種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

フタル酸エステル類 8 種混合標準液のうちへ キサン希釈のものであって、フタル酸ジエチ ル、フタル酸ジー nープロピル、フタル酸ジ ー nーブチル、フタル酸ジー nーペンチル、 フタル酸ジー nーへキシル、フタル酸ジー 2 ーエチルヘキシル、フタル酸ジシクロヘキシ ル及びフタル酸ブチルベンジルの各濃度が 1 O O ミリグラム毎リットルのもの

フタル酸エステル類 8 種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

フタル酸ジー nープロピル標準液のうちへキサン希釈のものであって、濃度が 1 O O ミリグラム毎リットルのもの

フタル酸ジー nープロピル標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

フタル酸ジー nーペンチル標準液のうちへキサン希釈のものであって、濃度が 1 0 0 ミリグラム毎リットルのもの

フタル酸ジー nーペンチル標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

フタル酸ジー nーへキシル標準液のうちへキ サン希釈のものであって、濃度が 1 0 0 ミリ グラム毎リットルのもの フタル酸ジー nーへキシル標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する有機標準液製造装置を用いて製造されたもの

フタル酸ジシクロヘキシル標準液のうちヘキ サン希釈のものであって、濃度が 1 O O ミリ グラム毎リットルのもの フタル酸ジシクロヘキシル標準液で あって、一般財団法人化学物質評価 研究機構が保管する有機標準液製造 装置を用いて製造されたもの

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカーマ率校正用の軟エックス線用電離箱式照射線量計であって、エックス線の実効エネルギー範囲が10キロボルト以上40キロボルト未満の電圧で加速された電子によって生じるエネルギー範囲の場合において、校正範囲が照射線量における放射線の量が1マイクロクーロン毎キログラム以上0.1クーロン毎キログラム以下のもの

平行平板型自由空気電離箱式照射線 量設定装置であって、国立研究開発 法人産業技術総合研究所が保管する もの

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量 率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカー マ率校正用の中硬エックス線用電離箱式照射 線量計であって、エックス線の実効エネルギ 一範囲が40キロボルト以上250キロボル ト以下の電圧で加速された電子によって生じ るエネルギー範囲の場合において、校正範囲 が照射線量における放射線の量が1マイクロ クーロン毎キログラム以上0. 1クーロン毎 キログラム以下のもの 照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量 グラファイト壁空洞電離箱式照射線 率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカー 量設定装置であって、国立研究開発 マ率校正用のガンマ線用電離箱式照射線量計 法人産業技術総合研究所が保管する であって、ガンマ線源の核種がセシウム13 もの 7の場合において、校正範囲が照射線量にお ける放射線の量が100ナノクーロン毎キロ グラム以上 0. 1クーロン毎キログラム以下 のもの及びコバルト60の場合において、校 正範囲が照射線量における放射線の量が10 0ナノクーロン毎キログラム以上5クーロン 毎キログラム以下のもの 放射能絶対測定装置群であって、国 標準線源付加圧型電離箱、ガンマスペクトロ メータ、液体シンチレーションカウンタ又は 立研究開発法人産業技術総合研究所 荷電粒子測定装置であって、校正範囲が50 が保管するもの 0ベクレル以上100メガベクレル以下のも ロックウエル硬さ標準片であって、校正範囲 ロックウエル硬さ標準機であって、 が20HRC以上65HRC以下のもの 国立研究開発法人産業技術総合研究 所が保管するもの ビッカース硬さ標準片であって、校正範囲が ビッカース硬さ標準機であって、国 200HV以上900HV以下のもの 立研究開発法人産業技術総合研究所 が保管するもの 露点計であって、校正範囲が露点でー70度 標準湿度発生装置群であって、国立 以上85度以下のもの 研究開発法人産業技術総合研究所が 保管するもの 国立研究開発法人 減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は 標準エアライン群であって、国立研 産業技術総合研究所 |終端器のうち、線路が3.5ミリメートル同 究開発法人産業技術総合研究所が保 軸構造を有するものであって、周波数が〇... 管するもの 1ギガヘルツ以上33ギガヘルツ以下の場合 において、入射波と反射波との比又は入射波 と透過波との比が1以下のもの

	光電検出器であって、波長が1310ナノメ	光減衰量測定装置であって、国立研
	ートル及び電力が1ミリワットの場合におい	究開発法人産業技術総合研究所が保
	て、校正範囲が9デシベル以上90デシベル	管するもの
	以下のもの	
	白金抵抗温度計であって、特定標準器による	温度定点群実現装置であって、国立
	校正が行われる温度が一189度のもの	研究開発法人産業技術総合研究所が
		保管するもの
	レーザ干渉式振動測定装置又は振動加速度計	レーザ干渉式振動測定装置であっ
	 であって、校正範囲が0.1ヘルツ以上10	 て、国立研究開発法人産業技術総合
	キロヘルツ以下(1ヘルツ以上5キロヘルツ	研究所が保管するもの
	以下を除く)のもの	
国立研究開発法人	液体流量校正装置であって、校正範囲が O .	│ │液体流量校正設備であって、国立研
産業技術総合研究所		究開発法人産業技術総合研究所が保
建木以門心口切	トル毎時未満のもの	管するもの
	T	石油用流量校正設備であって、国立
	方メートル毎時以上3立方メートル毎時未満	研究開発法人産業技術総合研究所が
	のもの又は、〇. 〇22キログラム毎秒以上	保管するもの
	0.67キログラム毎秒未満のもの	休官するもの
		京田沙浦京島測点社界でもって 日
	同軸固定減衰器であって、校正範囲が60デ	高周波減衰量測定装置であって、国
	シベルを超え80デシベル以下の場合におい	立研究開発法人産業技術総合研究所
	て、周波数範囲が10メガヘルツ以上18ギ	が保管するもの
	ガヘルツ以下のもの又は校正範囲が60デシ	
	ベル以下の場合において、周波数範囲が10	
	メガヘルツ以上40ギガヘルツ以下のもの	
	速中性子フルエンス校正用の減速材付中性子	速中性子フルエンス絶対測定装置群
	検出器であって、エネルギーが144キロ電	であって、国立研究開発法人産業技
	子ボルト、565キロ電子ボルト、5メガ電	術総合研究所が保管するもの
	子ボルト又は14. 8メガ電子ボルトの場合	
	において、校正範囲が10 [°] 毎平方センチメー	
	トル以上10′毎平方センチメートル以下のも	
	Ø	
一般財団法人化学物	揮発性有機化合物12種混合標準ガスのうち	揮発性有機化合物 1 2 種混合標準ガ
質評価研究機構	窒素希釈のものであって、1, 1-ジクロロ	スであって、一般財団法人化学物質
	エチレン、ジクロロメタン、 <i>cis</i> -1,2	評価研究機構が保管する標準ガス製
	ージクロロエチレン、1, 1, 1ートリクロ	造用精密天びん、標準ガス調製装置
	ロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、	及び分析計測装置(以下「標準ガス
	四塩化炭素、ベンゼン、1, 2-ジクロロエ	製造装置」という。)を用いて製造
	タン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ	されたもの
	チレン、 <i>c i s</i> – 1, 3 – ジクロロプロペン	
	及び <i>t r a n s</i> - 1, 3 - ジクロロプロペン	
	の各濃度が 1 体積百万分率のもの	
I	<u> </u>	<u> </u>

揮発性有機化合物 7 種混合標準ガスのうち窒素希釈のものであって、アセトアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、スチレン、*o*ーキシレン、*m*ーキシレン及び *p*ーキシレンの各濃度が 1 体積百万分率のもの

揮発性有機化合物7種混合標準ガス であって、一般財団法人化学物質評 価研究機構が保管する標準ガス製造 装置を用いて製造されたもの

アセトアルデヒド標準ガスのうち窒素希釈の ものであって、濃度が 1 体積百万分率のもの

アセトアルデヒド標準ガスであって、一般財団法人化学物質評価研究 機構が保管する標準ガス製造装置を 用いて製造されたもの

ほう素標準液であって、濃度が 1 グラム毎リットルのもの

ほう素標準液であって、一般財団法 人化学物質評価研究機構が保管する 標準液製造用精密天びん、超純水製 造装置及び分析計測装置(以下「標 準液製造装置」という。)を用いて 製造されたもの

金属15種混合標準液であって、アルミニウム、ほう素、カルシウム、カドミウム、コバルト、クロム、銅、鉄、カリウム、マグネシウム、マンガン、ナトリウム、ニッケル、鉛及び亜鉛の各濃度が10ミリグラム毎リットル以下のもの

金属15種混合標準液であって、一般財団法人化学物質評価研究機構が保管する標準液製造装置を用いて製造されたもの

陰イオン7種混合標準液であって、ふっ化物イオン濃度が5ミリグラム毎リットル以上20ミリグラム毎リットル以上20ミリグラム毎リットル以上20ミリグラム毎リットル以上100濃度が10ミリグラム毎リットル以下、硝酸イオン濃度が30ミリグラム毎リットル以上100ミリグラム毎リットル以下、りん酸イオン濃度が30年リットル以下及び硫酸イオン濃度が40ミリグラム毎リットル以下及び硫酸イオン濃度が40ミリグラム毎リットル以下のもの

陰イオン7種混合標準液であって、 一般財団法人化学物質評価研究機構 が保管する標準液製造装置を用いて 製造されたもの

ホルムアルデヒド標準液のうちメタノール希 釈のものであって、濃度が1グラム毎リット ルのもの ホルムアルデヒド標準液であって、 一般財団法人化学物質評価研究機構 が保管する標準液製造用精密天びん 及び分析計測装置を用いて製造され たもの 国立研究開発法人

532ナノメートルよう素分子吸収線波長安 産業技術総合研究所 定化レーザ装置、1.5マイクロメートル帯 (Cバンド)アセチレン分子吸収線波長安定 化レーザ装置及び1.5マイクロメートル帯 (Cバンド)シアン化水素分子吸収線波長安 定化レーザ装置

協定世界時に同期した原子時計及び 光周波数コム装置であって、国立研 究開発法人産業技術総合研究所が保 管するもの

交流電圧用交直変換器であって、周波数が1 0ヘルツ以上 1メガヘルツ以下の場合におい て、校正範囲が10ミリボルト以上1キロボ ルト以下のもの

交流電圧用及び交流電流用交直変換 器並びに交直差測定装置であって、 国立研究開発法人産業技術総合研究 所が保管するもの

交流電流用交直変換器であって、周波数が1 0ヘルツ以上100キロヘルツ以下の場合に おいて、校正範囲が10ミリアンペアのもの

減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は 終端器のうち、線路がN型同軸構造を有する ものであって、周波数が0.04ギガヘルツ 以上18ギガヘルツ以下の場合において、入 射波と反射波との比又は入射波と透過波との 比が1以下のもの

標準エアライン群であって、国立研 究開発法人産業技術総合研究所が保 管するもの

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量 率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカー マ率校正用の軟エックス線用電離箱式照射線 量計であって、エックス線の実効エネルギー 範囲が40キロボルト以上50キロボルト以 下の電圧で加速された電子によって生じるエ ネルギー範囲の場合において、校正範囲が照 射線量における放射線の量が1マイクロクー ロン毎キログラム以上0. 1クーロン毎キロ グラム以下のもの

平行平板型自由空気電離箱式照射線 量設定装置であって、国立研究開発 法人産業技術総合研究所が保管する もの

照射線量、照射線量率、吸収線量、吸収線量 率、線量当量、線量当量率、カーマ又はカー マ率校正用の中硬エックス線用電離箱式照射 線量計であって、エックス線の実効エネルギ 一範囲が30キロボルト以上40キロボルト 未満又は250キロボルト以上300キロボ ルト以下の電圧で加速された電子によって生 じるエネルギー範囲の場合において、校正範 囲が照射線量における放射線の量が1マイク ロクーロン毎キログラム以上 0. 1クーロン 毎キログラム以下のもの

	吸収線量又は吸収線量率校正用のベータ線用	外挿電離箱であって、国立研究開発
	測定器のうちベータ線源が次の各号に掲げる	法人産業技術総合研究所が保管する
	場合に、校正範囲が当該各号に掲げるもの	本人産来び刑総占別九別が休官する
	一 ストロンチウム90及び放射平衡中のイ	000
	ットリウム90 吸収線量における両核	
	種からの放射線の合計量が0.11ミリ	
	グレイ以上40ミリグレイ以下	
	ニ クリプトン85 吸収線量における放射	
	線の量が0.38ミリグレイ以上140	
	ミリグレイ以下	
	三 プロメチウム147 吸収線量における	
	放射線の量が20マイクログレイ以上	
	7. 2ミリグレイ以下	
	速中性子フルエンス校正用の減速材付中性子	速中性子フルエンス絶対測定装置群
	検出器であって、中性子線源がアメリシウム	であって、国立研究開発法人産業技
	241―ベリリウム又はカリホルニウム25	術総合研究所が保管するもの
	2の場合において、校正範囲が103毎平方セ	
	ンチメートル以上107毎平方センチメートル	
	以下のもの	
一般財団法人化学物	セシウム標準液であって、濃度が 1 グラム毎	セシウム標準液であって、一般財団
質評価研究機構	リットルのもの	法人化学物質評価研究機構が保管す
		る標準液製造用精密天びん、超純水
		製造装置及び分析計測装置(以下
		「標準液製造装置」という。)を用
		いて製造されたもの
	ガリウム標準液であって、濃度が1グラム毎	ガリウム標準液であって、一般財団
	リットルのもの	 法人化学物質評価研究機構が保管す
		 る標準液製造装置を用いて製造され
		たもの
		インジウム標準液であって、一般財
	毎リットルのもの	団法人化学物質評価研究機構が保管
		する標準液製造装置を用いて製造さ
		れたもの
	 テルル標準液であって、濃度が1グラム毎リ	プログラン プログラン アルル標準液であって、一般財団法
	ットルのもの	人化学物質評価研究機構が保管する
	7 1 7007 007	標準液製造装置を用いて製造された
		標学 成 表 但 を 用 い く 表 但 で れ い こ
		バナジウム標準液であって、一般財
	毎リットルのもの	団法人化学物質評価研究機構が保管
		する標準液製造装置を用いて製造さ
		れたもの

国立研究開発法人	分光放射照度標準電球であって、校正範囲が	分光放射輝度照度測定装置であっ
産業技術総合研究所	200ナノメートル以上400ナノメートル	て、国立研究開発法人産業技術総合
	以下のもの	研究所が保管するもの
	電流比較器であって、周波数が45ヘルツ以	交流電流比校正装置であって、国立
	上65ヘルツ以下の場合において、校正範囲	研究開発法人産業技術総合研究所が
	が50アンペア以下のもの	保管するもの
	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は	標準エアライン群であって、国立研
	終端器のうち、線路が7ミリメートル同軸構	究開発法人産業技術総合研究所が保
	造を有するものであって、周波数が 0.04	管するもの
	ギガヘルツ以上18ギガヘルツ以下の場合に	
	おいて、入射波と反射波との比又は入射波と	
	透過波との比が1以下のもの	
国立研究開発法人	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は	標準終端器群であって、国立研究開
産業技術総合研究所	終端器のうち、これらの線路が同軸構造を有	発法人産業技術総合研究所が保管す
	し、かつ、その外部導体の内径が7ミリメー	るもの
	トルのものであって、9キロヘルツ以上0.	
	O 4 ギガヘルツ未満の周波数の高周波信号を	
	当該線路に通した場合において、入射波の強	
	度に対する反射波の強度の比を示す数値又は	
	入射波の強度に対する透過波の強度の比を示	
	す数値のいずれかの数値が1以下であるもの	
	吸収線量又は吸収線量率を計量する計量器を	グラファイト壁空洞電離箱式照射線
	校正するために用いられるガンマ線水吸収線	量設定装置及びグラファイトカロリ
	量用電離箱式線量計であって、0. 1グレイ	メータであって、国立研究開発法人
	以上220グレイ以下の一定の水吸収線量	産業技術総合研究所が保管するもの
	(コバルト60を線源として用いる場合にお	
	ける当該線源から発せられるガンマ線に係る	
	水吸収線量をいう。)を計量するもの	
	照度応答度標準受光器であって、校正の対象	単色平行光発生装置、分光視感効率
	となる照度の範囲が1ルクス以上3000ル	近似受光器、比較受光器及び自己校
	クス以下のもの	正測定装置であって、国立研究開発
		法人産業技術総合研究所が保管する
		もの
	├── 隔膜真空計であって、校正範囲が0.1パス	中真空標準装置であって、国立研究
	カル以上150パスカル以下のもの	開発法人産業技術総合研究所が保管
		するもの

平成27年11月2日公示分				
国立研究開発法人	赤外放射温度計であって、特定標準器による	温度定点群実現装置であって、国立		
産業技術総合研究所	校正等が行われる範囲(以下、「校正範囲」	研究開発法人産業技術総合研究所が		
	という。)が一30度以上160度以下のも	保管するもの		
	Ø			
日本電気計器検定所	単色放射温度計であって、校正範囲が200	単色放射温度計であって、日本電気		
	0度を超え2800度以下のもの	計器検定所が保管するもの		
国立研究開発法人	気体流量校正装置であって、校正範囲が18	気体流量校正設備であって、国立研		
産業技術総合研究所	0グラム毎分を超え、400グラム毎分以下	究開発法人産業技術総合研究所が保		
	のもの	管するもの		
	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は	標準終端器群であって、国立研究開		
	終端器のうち、これらの線路がN型同軸構造	発法人産業技術総合研究所が保管す		
	を有するもの及び同軸構造を有し、かつ、そ	るもの		
	の外部導体の内径が3.5ミリメートルのも			
	のであって、9キロヘルツ以上0.04ギガ			
	ヘルツ未満の周波数の高周波信号を当該線路			
	に通した場合において、入射波の強度に対す			
	る反射波の強度の比を示す数値又は入射波の			
	強度に対する透過波の強度の比を示す数値が			
	1以下であるもの			
	減衰器、エアライン、ミスマッチライン又は	標準エアライン群であって、国立研		
	終端器のうち、これらの線路が同軸構造を有	究開発法人産業技術総合研究所が保		
	し、かつ、その外部導体の内径が3.5ミリ	管するもの		
	メートルのものであって、0.04ギガヘル			
	ツ以上〇. 1ギガヘルツ未満の周波数の高周			
	波信号を当該線路に通した場合において、入			
	射波の強度に対する反射波の強度の比を示す			
	数値又は入射波の強度に対する透過波の強度			
	の比を示す数値が1以下であるもの			
	可変減衰器のうち、線路が同軸構造を有する	·		
	ものであって、10メガヘルツ以上12ギガ	立研究開発法人産業技術総合研究所		
	ヘルツ以下の周波数の高周波信号を当該線路	が保管するもの		
	に通した場合において、校正範囲が100デ			
	シベルを超え110デシベル以下のもの、1			
	2 ギガヘルツを超え 1 8 ギガヘルツ以下の周			
	波数の高周波信号を当該線路に通した場合に			
	おいて、校正範囲が60デシベルを超え11			
	○デシベル以下のもの及び40ギガヘルツを			
	超え50ギガヘルツ以下の周波数の高周波信			

号を当該線路に通した場合において、校正範 囲が60デシベル以下のもの

可変移相器のうち、線路が同軸構造を有する ものであって、10メガヘルツ以上1ギガヘ ルツ以下の周波数の高周波信号を当該線路に 通した場合において、減衰量が60デシベル 以下のもの

ループアンテナであって、電磁波の周波数が |標準アンテナ群であって、国立研究 9キロヘルツ以上30メガヘルツ以下のも の、バイコニカルアンテナであって、電磁波 | するもの の周波数が30メガヘルツ以上300メガヘ ルツ以下のもの、ログペリオディックアンテ ナであって、電磁波の周波数が300メガへ ルツ以上 1 ギガヘルツ以下のもの及びボウタ イアンテナとログペリオディックアンテナの 複合アンテナであって、電磁波の周波数が3 0メガヘルツ以上1ギガヘルツ以下のもの

開発法人産業技術総合研究所が保管

レーザビーム用熱型光パワー測定装置であっ│カロリーメータ方式レーザパワー測 て、波長が405ナノメートル帯の場合にお 定装置であって、国立研究開発法人 いて校正範囲が50マイクロワット以上10 産業技術総合研究所が保管するもの ミリワット以下のもの

熱中性子測定器であって、中性子フルエンス |熱中性子フルエンス絶対測定装置で 率の校正範囲が、50毎平方センチメートル局ので、国立研究開発法人産業技術 毎秒以上10⁴毎平方センチメートル毎秒以 下のもの

総合研究所が保管するもの

中性子放出率測定器であって、中性子線源が | 中性子放出率基準測定装置であっ アメリシウム241-ベリリウム又はカリホ | て、国立研究開発法人産業技術総合 ルニウム252の場合において校正範囲が1 0 3 毎秒以上 1 0 7 毎秒以下のもの

研究所が保管するもの

カーマ率校正用の井戸型電離箱式線量計であ | 密封小線源カーマ率設定装置であっ って、線源の核種がよう素125の場合にお て、国立研究開発法人産業技術総合 いて、校正範囲が空気カーマ率について 0... 3マイクログレイ毎時以上15マイクログレ イ毎時以下のもの

|研究所が保管するもの

吸収線量を計量する計量器を校正するために | グラファイト壁空洞電離箱式照射線 用いられる水吸収線量用電離箱式線量計であり って1グレイ以上200グレイ以下の一定の メータであって、国立研究開発法人 水吸収線量(公称加速電圧が6メガボルト、 10メガボルト及び15メガボルトで加速さ れた電子により生じた光子線の水吸収線量を いう)を計量するもの

量設定装置及びグラファイトカロリ 産業技術総合研究所が保管するもの 質評価研究機構

-般財団法人化学物 |エタノール標準ガスのうち窒素希釈のもので |エタノール標準ガスであって、一般 あって、濃度が20体積百万分率以上100 財団法人化学物質評価研究機構が保 体積百万分率未満のもの及び空気希釈のもの「管する標準ガス製造用精密天びん、 であって、濃度が20体積百万分率以上10 標準ガス調製装置及び分析計測装置 O体積百万分率未満のもの

> 臭素酸イオン標準液であって、濃度が2グラ |臭素酸イオン標準液であって、一般 ム毎リットルのもの

を用いて製造されたもの

財団法人化学物質評価研究機構が保 管する標準液製造用精密天びん、超 純水製造装置及び分析計測装置(以 下、「標準液製造装置」という。)を 用いて製造されたもの

塩素酸イオン標準液であって、濃度が1グラ |塩素酸イオン標準液であって、一般 ム毎リットルのもの

財団法人化学物質評価研究機構が保 管する標準液製造装置を用いて製造 されたもの

揮発性有機化合物25種混合標準液のうちメ | 揮発性有機化合物25種混合標準液 タノール希釈のものであって、ジクロロメタ ン、ジブロモクロロメタン、四塩化炭素、ク|価研究機構が保管する標準液製造用 ロロホルム、トリブロモメタン、ブロモジク ロロメタン、1、2-ジクロロエタン、1、 1. 1ートリクロロエタン、1. 1. 2ート リクロロエタン、1、1ージクロロエチレ ン、cis-1、2-ジクロロエチレン、trans-1, 2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、 1. 2-ジクロロプロパン、*cis*-1. 3 ージクロロプロペン、 *t r a n s* - 1, 3 -ジクロロプロペン、1、4-ジクロロベンゼ ン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシ レン、ベンゼン、トルエン、1,4-ジオキ サン及び tーブチルメチルエーテルの各濃度 が1グラム毎リットルのもの

であって、一般財団法人化学物質評 精密天びん及び分析計測装置を用い て製造されたもの

平成29年2月6日公示分				
国立研究開発法人	参照用トルクメータであって、校正範囲が	トルク標準機群であって、国立研究		
産業技術総合研究所	0. 1ニュートンメートル以上5ニュートン	開発法人産業技術総合研究所が保管		
	メートル未満のもの及び参照用トルクレンチ	するもの		
	であって、校正範囲が0.1ニュートンメー			
	トル以上5ニュートンメートル未満又は1キ			
	ロニュートンメートルを超え 5 キロニュート			
	ンメートル以下のもの			
	ピト一静圧管であって、校正範囲が40メー	気体流速校正設備であって、国立研		
	トル毎秒以上90メートル毎秒以下のもの	究開発法人産業技術総合研究所が保		
		管するもの		
	電界プローブであって、電磁波の周波数が2	標準アンテナ群であって、国立研究		
	0 メガヘルツ以上 2 ギガヘルツ以下の場合に	開発法人産業技術総合研究所が保管		
	おいて、電界の強さが10ボルト毎メートル	するもの		
	のもの			
	カーマ率校正用の井戸型電離箱式線量計であ	グラファイト壁空洞電離箱式照射線		
	って、線源の核種がイリジウム192の場合	量計設定装置であって、国立研究開		
	において、校正範囲が空気カーマ率について	発法人産業技術総合研究所が保管す		
	5ミリグレイ毎時以上70ミリグレイ毎時以	るもの		
	下のもの			
一般財団法人化学物	全有機体炭素標準液であって、濃度が 1 グラ	全有機体炭素標準液であって、一般		
質評価研究機構	ム毎リットルのもの	財団法人化学物質評価研究機構が保		
		管する標準液製造用精密天びん、超		
		純水製造装置及び分析計測装置を用		
		いて製造されたもの		

平成30年7月6日公示				
国立研究開発法人	分光全放射束標準光源であって、校正範囲が	自己校正測定装置、比較受光器、単		
産業技術総合研究所	波長において360ナノメートル以上830	色平行光発生装置、分光視感効率近		
	ナノメートル以下のもの	似受光器、配光測定装置及び分光放		
		射輝度照度測定装置であって、国立		
		研究開発法人産業技術総合研究所が		
		保管するもの		
一般財団法人化学物	フェノール類6種混合標準液のうちアセトン	フェノール類6種混合標準液であっ		
質評価研究機構	希釈のものであって、フェノール、2-クロ	て、一般財団法人化学物質評価研究		
	ロフェノール、4ークロロフェノール、2,	機構が保管する標準液製造用精密天		
	4 - ジクロロフェノール、2, 6 - ジクロロ	びん及び分析計測装置(以下「有機		
	フェノール及び2, 4, 6ートリクロロフェ	標準液製造装置」という。)を用い		
	ノールの各濃度が 1 グラム毎リットルのもの	て製造されたもの		
	かび臭物質2種混合標準液のうちメタノール	かび臭物質2種混合標準液であっ		
	希釈のものであって、ジェオスミン及び2-	て、一般財団法人化学物質評価研究		
	メチルイソボルネオールの各濃度が100ミ	機構が保管する有機標準液製造装置		
	リグラム毎リットルのもの	を用いて製造されたもの		
	ハロ酢酸4種混合標準液のうち t ーブチルメ	ハロ酢酸4種混合標準液であって、		
	チルエーテル希釈のものであって、クロロ酢	一般財団法人化学物質評価研究機構		
	酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸及びブロ	が保管する有機標準液製造装置を用		
	モ酢酸の各濃度が 1 グラム毎リットルのもの	いて製造されたもの		
	銀標準液であって、濃度が1グラム毎リット	銀標準液であって、一般財団法人化		
	ルのもの	学物質評価研究機構が保管する標準		
		液製造用精密天びん、超純水製造装		
		置及び分析計測装置(以下「標準液		
		製造装置」という。)を用いて製造		
		されたもの		
	亜塩素酸イオン標準液であって、濃度が 1 グ	亜塩素酸イオン標準液であって、一		
	ラム毎リットルのもの	般財団法人化学物質評価研究機構が		
		保管する標準液製造装置を用いて製		
		造されたもの		